

日本金属学会 1990 年秋期大会 日程一覽

	9月25日(火)			9月26日(水)			9月27日(木)		
	午	午後	夜	午	午後	夜	午	午後	夜
A 棟1階	9:00~10:15 大会実行委員長挨拶								
B 棟1階	超伝導材料(1) 1~3 (10:30~11:15)	超伝導材料(1) (特別講演1) 4~16 (13:00~16:50)	超伝導材料(2) 17~26 (9:00~11:50)	超伝導材料(3) 27~41 (13:00~17:05)	超伝導材料(3) 42~51 (9:00~11:50)	超伝導材料(3) 52~63 (13:00~16:10)			
B 棟1階	超塑性 64~67 (特別講演1) (10:30~12:00)	超塑性 68~72 高温変形・タリオン(1) (10:30~16:45)	高温変形・タリオン(2) 81~90 (9:15~12:00)	高温変形・タリオン(2) 91~98 (13:00~15:15)	水素 99~106 (特別講演1) S ₃ 固体破壊の物理と化学(2) 14~19 (9:00~12:00)	水素 107~120 (特別講演1) S ₄ 表面、界面分析の工業的応用 16 (9:00~12:00)			
C 棟1階	内部摩擦 121~124 機械的性質 125~128 (10:30~12:35)	機械的性質 129~142 (13:30~17:10)	照射損傷(1) 157~171 (13:00~16:05)	照射損傷(2) 172~182 (9:00~12:05)	照射損傷(3) 198~208 (9:00~12:05)	照射損傷(3) 209~216 (13:00~15:10)			
C 棟1階	金属間化合物(1) 217~220 (10:45~11:45)	金属間化合物(1) 221~234 (13:00~16:50)	金属間化合物(2) 235~244 (9:00~11:40)	金属間化合物(2) 245~256 (13:00~16:20)	金属間化合物(3) 257~267 (9:00~11:55)	金属間化合物(3) 268~281 (13:00~16:40)			
C 棟1階	表面改質 318~321 (11:00~12:00)	表面改質 322~333 (13:00~16:20)	表面処理 334~343 (9:15~12:00)	表面解析 344~353 (13:00~15:45)	表面解析 354~365 (9:00~12:20)	表面解析 366~377 (13:00~15:55)			
C 棟2階	S ₂ ベイナイト変態における最近の問題点 1~3 (10:30~12:05)	S ₂ ベイナイト変態における最近の問題点 4~11 (13:00~17:05)	マルテンサイト(1) 354~365 (9:00~12:20)	マルテンサイト(1) 366~377 (13:00~16:50)	マルテンサイト(2) 378~386 (9:00~11:25)	マルテンサイト(2) 387~394 (13:00~15:10)			
C 棟2階	電子顕微鏡・ X線回折 395~400 (10:30~12:00)	電子顕微鏡・ X線回折 401~414 (13:00~16:55)	電子顕微鏡・ X線回折 415~420 (9:00~11:55)	電子顕微鏡・ X線回折 421~431 (13:00~16:40)	S ₁ 材料研究のための回折結晶学的手法(1) 7~13 (9:00~11:55)	S ₁ 材料研究のための回折結晶学的手法(2) 14~19 (13:00~15:30)			
C 棟2階	薄膜 415~420 (10:30~12:05)	薄膜 421~431 (13:00~16:25)	時効析出(1) 432~440 (9:30~11:55)	時効析出(1) 441~454 (13:00~16:50)	時効析出(2) 455~466 (9:35~12:00)	時効析出(2) 467~467 (13:00~14:00)			
K 棟2階	格子欠陥 468~473 (10:30~12:05)	格子欠陥 474~483 (13:00~16:00)	格子欠陥 484~495 (9:00~12:10)	格子欠陥 496~508 (13:00~16:35)	格子欠陥 509~520 (9:00~12:10)	格子欠陥 521~534 (13:00~16:50)			
L 棟2階	S ₆ 種々のプロセスによる超微細 組織の生成とその制御 (基調講演1) 1~3 (10:30~12:00)	S ₆ 種々のプロセスによる超微細 組織の生成とその制御 4~12 (13:00~17:00)	軟質磁性材料(1) 535~543 (9:30~11:55)	軟質磁性材料(1) 544~547 特殊材料 548~556 (13:00~16:55)	軟質磁性材料 557~568 (9:00~12:10)	軟質磁性材料(2) 569~572 (13:00~14:00)			
M 棟3階	非晶質(1) 583~588 (10:30~12:00)	非晶質(1) 589~602 (13:00~17:00)	非晶質(2) 603~612 (9:15~12:00)	非晶質(2) 613~621 非平衡 622~631 (13:15~17:00)	非晶質(3) 622~627 (9:30~11:00)	非晶質(3) 628~640 (13:00~15:25)			
N 棟3階	複合材料(1) 641~645 (10:30~11:45)	複合材料(1) 646~660 (13:00~17:00)	複合材料(2) 661~676 (9:00~11:40)	複合材料(2) 677~683 (13:00~17:05)	粉末冶金 684~692 (9:20~12:00)	粉末冶金 693~708 (13:00~17:00)			
P 棟3階	セラミックス(I) 709~713 (10:30~11:45)	セラミックス(I) 714~727 (13:00~16:50)	セラミックス(2) 728~737 (9:00~11:40)	セラミックス(2) 738~749 (13:00~16:20)	セラミックス(2) 750~761 (9:00~11:55)	セラミックス(2) 762~768 (13:00~16:30)			
Q 棟3階	傾斜機能材料 超微粉 800~803 (13:00~16:05)	傾斜機能材料 超微粉 804~810 (13:00~16:50)	電子線 811~819 (9:15~11:45)	電子線 820~833 (13:00~16:50)	電子線 834~842 (9:15~11:45)	電子線 843~850 (13:00~15:15)			
R 棟3階	高温冶金反応 851~854 (10:30~11:30)	高温冶金反応 855~861 イオン伝導体 862~865 (13:00~16:00)	融体物性 866~871 (9:00~11:45)	融体物性 872~875 (13:00~16:20)	融体物性 876~887 (9:00~12:00)	融体物性 888~891 (13:00~15:55)			
S 棟4階	再結晶・粒成長 910~921 (9:00~12:20)	再結晶・粒成長 922~934 (13:20~16:55)	薄膜の作製(1) 935~944 (9:00~11:50)	薄膜の作製(1) 945~959 (13:00~17:10)	薄膜の作製(2) 960~970 (9:00~11:55)	薄膜の作製(2) 971~975 (13:00~14:15)			